

&lt; 日本特許・実用新案明細書収録セット &gt;

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

## ハードディスク研磨用組成物

\*\*\*\*\*

[ 公開編 ] 平成10年~平成12年(3年間) 61点

\*電子BOOK版新登場! 全文PDF CD-ROM版 ￥21,800-  
全文紙収録 全文公報版 ￥21,800-

## 既刊関連セットのご案内

No,8494	公開特許	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	￥23,500
No,8701(B)	"	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	￥21,000
No,"(A)	"	"	平.7-8	56点	￥19,000
No,8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	￥35,000
No,8963	"	フォトリソスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	￥27,700
No,9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	￥24,400
No,9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	￥40,000
No,8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	￥40,000
No,8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	￥40,000
No,8639	"	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	￥40,000
No,8632	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	89点	￥40,000
No,8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	￥40,000
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	￥27,800
No,8508	"	磁気ディスク用ガラス基板の製造方法	平.7-9	53点	￥21,700
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	￥23,700
No,8502	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.5-9	65点	￥24,800
No,8633	"	ステンレスの電解研磨加工法	平.5-10	73点	￥34,500
No,8641(B)	"	電気めっき用治具とめっき方法	平.8-10	90点	￥31,000
No,"(A)	"	"	平.5-7	91点	￥31,300
No,8826	登録・公開	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	￥24,800
No,8102	公告・公開	"	平.6-8	65点	￥23,700

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com) お電話でも承ります)

[ 電子Book版にはPDFしおり機能、原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

## お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. <span style="float: right;">CD-ROM版・全文公報版</span>
所属部署	題名
担当者名	合計 ¥
	( ) Fax ( )
住所 〒	

# ハードディスク研磨用組成物 No.9213

[公開編]平成10年～平成12年 61点

CD-ROM版 ¥21,800

全文公報版 ¥21,800

## 日本特許公開 平成10年

- 1 磁気ディスク基板研磨用組成物  
山口精研工業(株)
- 2 研磨剤組成物及びこれを用いた基板の製造方法  
花王(株)
- 3 研磨材組成物及びこれを用いたカーボン材料からなる基板の製造方法  
"
- 4 研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 5 " "
- 6 " "
- 7 アルミニウムディスクの研磨用組成物  
日産化学工業(株)
- 8 アルミニウムディスクの研磨用組成物及びその研磨用組成物を用いる研磨方法  
"
- 9 磁気ディスク基板の研磨用組成物  
昭和電工(株)
- 10 磁気ディスク基板研磨用組成物  
"
- 11 ハードディスク基板の研磨用組成物及びこれを用いた研磨方法  
三菱化学(株)
- 12 研磨液用洗浄剤組成物  
"
- 13 研磨液組成物及び研磨方法  
"
- 14 研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 15 リンス用組成物  
"
- 16 磁気記憶媒体の製造方法  
三菱化学(株)
- 17 磁気ディスク用基板のテクスチャ加工用スラリー  
富士電機(株)
- 18 磁気記録媒体用基板の研磨用パッド及び研磨方法  
(株)ニコン
- 19 アルミニウムの研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド

## 日本特許公開 平成11年

- 20 磁気ディスク基板用研磨剤および研磨方法  
昭和アルミニウム(株)
- 21 研磨液組成物  
花王(株)
- 22 研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 23 研磨用組成物および研磨方法  
"
- 24 研磨用組成物  
"
- 25 磁気ディスク基板の製造方法  
昭和アルミニウム(株)
- 26 " "
- 27 " "
- 28 " "
- 29 " "
- 30 ガラス研磨用研磨材組成物およびその研磨方法  
昭和電工(株)
- 31 研磨材組成物及びこれを用いた基板の製造方法  
花王(株)
- 32 アルミナ粉末及びその製造方法並びに研磨用組成物  
日産化学工業(株)
- 33 研磨剤組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 34 単結晶多面体アルミナを含むスラリー液  
日本マイクロテック(株)

- 35 多結晶ダイヤモンド微粉を含むスラリー液  
日本マイクロテック(株)
- 35 NiPめっきしたディスクを研磨するためのコロイドシリカスラリー  
コヌック Inc.
- 37 磁気ディスク基板用アルミニウム合金板用研削加工液及び研削加工方法  
三洋化成工業(株)

## 日本特許公開 平成12年

- 38 表面を研磨するためのハガンドまたはキレート剤を含有するスラリー  
コヌック Inc.
- 39 研磨液組成物  
花王(株)
- 40 磁気記録媒体基板用研磨材組成物及びこれを用いた磁気記録媒体基板の製造方法  
"
- 41 研磨剤スラリーおよびその調製方法  
(株)岡本工作機械s/s
- 42 研磨剤スラリー  
"
- 43 情報記憶媒体用ガラスセラミックス基板の研磨加工方法  
(株)オハラ
- 44 ガラス研磨用研磨材およびその研磨方法  
昭和電工(株)
- 45 磁気ディスク用基板及びその製造方法  
三菱化学(株)
- 46 磁気ディスク用基板の製造方法  
"
- 47 研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 48 磁気ディスク基板用アルミニウム合金板用研削加工液及び研削加工方法  
三洋化成工業(株)
- 49 テクスチャ加工液調製用組成物及びテクスチャ加工液  
協同油脂(株)
- 50 電解研磨併用磁気ディスク基板表面加工方法  
エー・ケ・テクノロジー - LTD
- 51 情報記憶媒体用基板の製造方法及び情報記憶媒体用基板  
(株)ニコン
- 52 磁気記憶媒体用結晶化ガラス基板の製造方法  
(株)三井金属プレジジョン
- 53 磁気ディスク用アルミニウム基板の製造方法および研磨装置  
日本軽金属(株)
- 54 E L I D平面研削盤の電極支持装置とその方法  
理化学研究所
- 55 E L I D用砥石とこれを用いたE L I D平面研削装置  
"
- 56 研磨用組成物  
(株)フジ・ミイコ・ホーレテッド
- 57 " "
- 58 " "
- 59 " "
- 60 研磨用組成物およびこれを用いた研磨方法  
"
- 61 " "

- 以上61点 -